MOORFIELD
NANOTECHNOLOGY

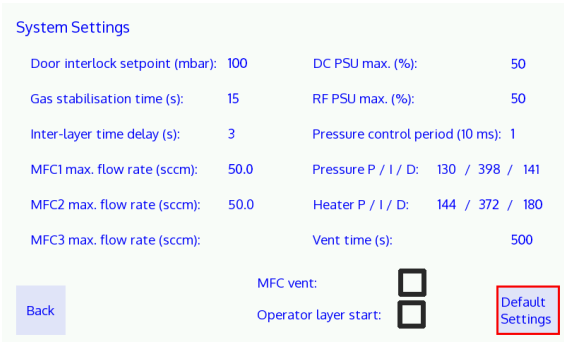
# 台式高性能多功能PVD薄膜制备系列—nanoPVD

nanoPVD-S10A磁控溅射系统

**nanoPVD S10A**最多可安装3个水冷式溅射源，可实现高功率持续运行。系统可以实现两源共溅射方案，可以实现反应溅射方案，最多可同时控制3路气体。系统具有分子泵，可快速达到5*$10^{-7}$mbar高真空。腔体取放样品非常方便，样品台最大尺寸8英寸，系统有智能化的触屏控制系统，采用完备的安全设计方案。

## 设备优势

- 可实现生长气压的高精度自动控制。
- 精准的条件控制和可靠的工艺重现性。
- 安全性设计，具有安全锁功能。
- 智能化设计，全自动引导式触屏操作系统。
- 支持自动程序的设定与储存。
- 多种配置可选。




智能的触屏控制系统

## 系统简介

该系列产品是为高水平学术研究研发的小型物理气相沉积设备。推出之后短短几年时间已经在欧洲销售了数十台，该系列产品包含了磁控溅射、金属/有机物热蒸发系统。这些设备虽然体积小巧，但是性能卓越，能够快速实现高质量纳米薄膜、异质结的制备，通常在大型设备中才有的共溅射和反应溅射功能也可以在该系列产品上实现。精准的有机物沉积系统更是该系列的一大特色。便捷的操作、智能的控制、高效的制备效率让您的学术研究进入快车道。

nanoPVD-T15A金属\有机物热蒸发系统

**nanoPVD T15A** 系统可以配备低温蒸发(LTE)和标准电阻蒸发源，分别用于沉积有机物和金属薄膜。低热容有机物蒸发源具有高精度的控制电源，可以精准的控制蒸发条件制备高质量的有机物薄膜。金属源采用盒式屏蔽模式，可以有效的减少交叉污染等问题。智能的控制系统和灵活的配置方案使PVD-T15A非常适合应用于材料研究领域。

Quantum Design China

Quantum Design
CHINA